(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月4日(04.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/182596 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/3065 (2006.01) *H05H 1/00* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/004848

(22) 国際出願日： 2025年2月14日(14.02.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-031556 2024年3月1日(01.03.2024) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(**TOKYO ELECTRON LIMITED**) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目３番１号 (JP).

(72) 発明者: 石川 聡(**ISHIKAWA Akira**); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ１番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP). 山平 聖(**YAMAHIRA Sho**); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ１番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP).

(74) 代理人: 佐 藤 睦, 外 (**SATO Atsushi** et al.); 〒1066123 東京都港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー２３階 ＴＭＩ総合法律事務所 (JP).

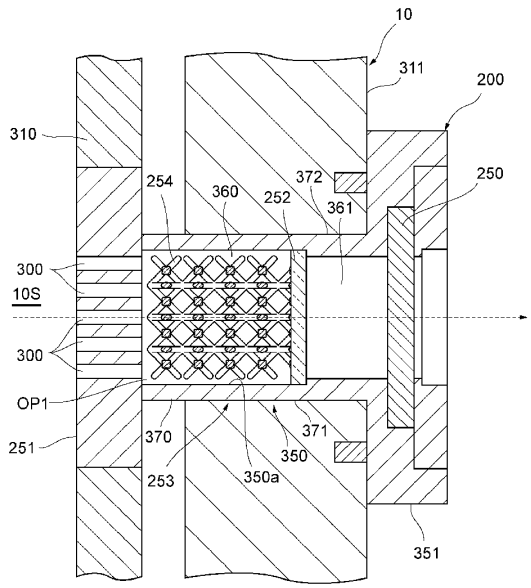
(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,

(54) **Title:** PLASMA TREATMENT DEVICE AND SUBSTRATE TREATMENT DEVICE

(54) 発明の名称： プラズマ処理装置及び基板処理装置

[図3]



(57) **Abstract:** Provided is a technique with which it is possible to recover a substance flowing out from a substrate treatment space. A plasma treatment device according to the present invention comprises a chamber having a plasma treatment space, and a plasma viewport attached to the chamber. The plasma viewport includes a first window, a second window disposed between the first window and the plasma treatment space, a third window disposed between the first window and the second window, and a lattice structure disposed between the second window and the third window.

(57) 要約：基板処理空間から流出する物質を回収することができる技術を提供する。プラズマ処理装置は、プラズマ処理空間を有するチャンバと、チャンバに取り付けられるプラズマビューポートと、を備え、プラズマビューポートは、第１の窓と、第１の窓とプラズマ処理空間との間に配置される第２の窓と、第１の窓と第２の窓との間に配置される第３の窓と、第２の窓と第３の窓との間に配置されるラティス構造体と、を含む。

WO 2025/182596 A1

［続葉有］

TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）